

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年4月3日(03.04.2025)



(10) 国際公開番号

WO 2025/070042 A1

(51) 国際特許分類:
C08F 220/06 (2006.01) C09K 3/14 (2006.01)
B24B 37/00 (2012.01) H01L 21/304 (2006.01)
C08L 33/02 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2024/032407

(22) 国際出願日: 2024年9月10日(10.09.2024)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2023-169438 2023年9月29日(29.09.2023) JP

(71) 出願人: 株式会社 レゾナック (RESONAC CORPORATION) [JP/JP]; 〒1057325 東京都港区東新橋一丁目9番1号 (JP).

(72) 発明者: 荒木 元章 (ARAKI Motoaki); 〒1057325 東京都港区東新橋一丁目9番1号 株式会社レゾナック内 (JP). 葛谷 卓也 (KUZUTANI Takuya); 〒1057325 東京都港区東新橋一丁目9番1号 株式会社レゾナック内 (JP). 市川 雄基 (ICHIKAWA Yuki); 〒1057325 東京都港区東新橋一丁目9番1号 株式会社レゾナック内 (JP). 田中 孝明 (TANAKA Takaaki); 〒1057325 東京都港区東新橋一丁目9番1号 株式会社レゾナック内 (JP). 松本 貴彬 (MATSUMOTO Takaaki); 〒1057325 東京都港区東新橋一丁目9番1号 株式会社レゾナック内 (JP).

(74) 代理人: 長谷川 芳樹, 外 (HASEGAWA Yoshiki et al.); 〒1000005 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 丸の内 M Y P L A Z A (明治安田生命ビル) 9階 創英国際特許法律事務所 (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))

(54) Title: POLYMER, POLYMER COMPOSITION, POLISHING LIQUID SET, POLISHING LIQUID, METHOD FOR PRODUCING POLISHING LIQUID, AND POLISHING METHOD

(54) 発明の名称: 重合体、重合体組成物、研磨液セット、研磨液、研磨液の製造方法、及び、研磨方法

(57) Abstract: A polymer for a polishing liquid, wherein the polymer has a first structural unit derived from at least one styrene compound selected from the group consisting of styrene and styrene derivatives and a second structural unit derived from at least one methacrylic acid compound selected from the group consisting of methacrylic acid and salts thereof, and the content of the first structural unit is from more than 0 mol % to 38 mol %.

(57) 要約: 研磨液用の重合体であって、前記重合体が、スチレン及びスチレン誘導体からなる群より選ばれる少なくとも一種のスチレン化合物に由来する第1の構造単位と、メタクリル酸及びその塩からなる群より選ばれる少なくとも一種のメタクリル酸化合物に由来する第2の構造単位と、を有し、前記第1の構造単位の含有量が0 mol %超38 mol %以下である、重合体。



WO 2025/070042 A1